

六、申請專利範圍

1. 一種研磨劑，其特徵為，研磨基板用之化學機械研磨用研磨劑，含有 (A)、(B)、(C)、(D) 及 (E)，

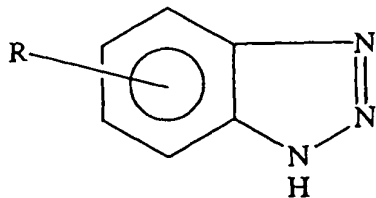
(A) 氧化微粒子、

(B) 氧化劑、

(C) 式 1 所表示之化合物 (但是 R 為氫原子、碳原子數為 1 至 4 個之烷基、碳原子數為 1 至 4 個之烷氧基或羧酸基)

(D) 水及

(E) 至少一種以上選自甲醇、乙醇、異丙醇、乙二醇、丙二醇、丙二醇甲基醚、丙二醇乙基醚、N-甲基-2-吡咯酮、N,N-二甲基甲醯胺、二甲基亞砷、 γ -丁內酯及碳酸丙烯酯所成群



... 式 1

2. 如申請專利範圍第 1 項之研磨劑，其更含有酸及 pH 緩衝液，pH 值為 2 至 9。

3. 如申請專利範圍第 1 項或第 2 項之研磨劑，其中該 (A) 為至少 1 種以上選自二氧化矽、氧化鋁、氧化鈣、氧化鋇、氧化鈦、氧化錫、氧化鎳、氧化鋅及氧化錳所成群。

4. 如申請專利範圍第 1 項或第 2 項之研磨劑，其中相對於研磨劑之總質量，含有 0.01 至 50 質量% 之該 (E) 以及含有 0.001 至 5 質量% 之該 (C)。

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

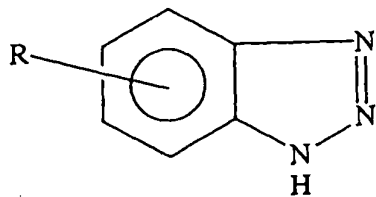
訂

六、申請專利範圍

5. 一種研磨劑的製造方法，其特徵為，含有

- (A) 氧化微粒子、
- (B) 氧化劑、
- (C) 式1所表示之化合物、
- (D) 水及

(E) 至少一種以上選自甲醇、乙醇、異丙醇、乙二醇、丙二醇、丙二醇甲基醚、丙二醇乙基醚、N-甲基-2-吡咯酮、N,N-二甲基甲醯胺、二甲基亞砷、 γ -丁內酯及碳酸丙烯酯所成群的有機溶媒之研磨基板用之化學機械研磨用研磨劑的製造方法，溶解該(C)於該(E)後，與分散該(A)於水之分散液混合



... 式1

6. 如申請專利範圍第5項之研磨劑的製造方法，其中添加酸及pH緩衝液，使pH值為2至9。

7. 如申請專利範圍第5項或第6項之研磨劑的製造方法，其中該(A)為至少1種以上選自二氧化矽、氧化鋁、氧化鈾、氧化鋯、氧化鈦、氧化錫、氧化鍺、氧化鋅及氧化錳所成群。

8. 一種研磨方法，其特徵為，供給研磨劑於研磨定盤上之研磨墊，與被研磨面接觸，使被研磨面及研磨墊進行相對運動之研磨方法中，使用如申請專利範圍第1項至第4項

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

訂

六、申請專利範圍

中任一項之研磨劑，研磨形成導線金屬膜及保護膜之基板

9.如申請專利範圍第8項之研磨方法，其中該保護膜為鉍、鉍合金或鉍化合物所形成，該導線金屬膜為銅、銅合金或銅化合物所形成。

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

表

訂